(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有權機関 國際事務局



(43) 国際公開日 2005年4月28日(28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/038936 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 33/00, 21/205

(21) 国際出願番号:

PCT/IP2004/015270

(22) 国際出願日:

2004年10月15日(15.10.2004)

(25) 国際出艇の言語:

日本語

(26) 國際公開の营語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2003-356955

05/

2003年10月16日(16.10.2003)

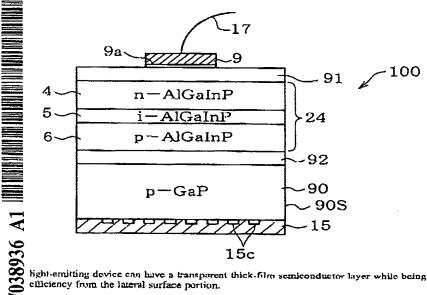
(71) 出願人(米国を除く全ての指定菌について): 信越半 專体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAL CO., LTD.) [JP/JP]: 〒1000005 東京都千代田区丸の内 1 丁目 4 番 2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

発明者/出願人 (米国についてのみ): 山田 雅人 (YA-MADA, Musalo) [JP/JP]; 〒3790196 群馬屎安中市磯 部二丁目 1 3 番 1 号 信 越半導体株式会社 碳部工場 內 Gunma (1P). 標原 改卷 (SHINOHARA, Masayuki) [JP/JP]; 〒3790196 群馬県安中市磯部二丁目 1 3 巻 1号 備越半導体株式会社 磯郎工場内 Gunma (JP), 高 福雅實 (TAKAHASHL Masanobu) [JP/JP]; 〒3790196 群馬県安中市磯部二丁目 13番1号 信越半導体株 式会社 磯部工場内 Gunna (JP). 安富 敬三 (ADOMI, Kelzou) [JP/JP]; 〒3790196 辞馬県安中市磯部二丁目 13番1号 個越半導体株式会社 半導体礎部研究所內 Gunma (JP). 池田 淳 (TKEDA, Jun) [JP/JP]; 〒3790196 群馬県安中市磯部二丁目 13番 1号 信越半導体株 式会社 半導体機部研究所内 Gunma (JP).

/翱築有]

- (54) Title: LIGHT-EMITTING DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME
- (54) 発明の名称: 発光素子及びその製造方法



Commission of the American Commission of the Commission of the American Commission of the Commission o

(57) Abstract: Disclosed is light-emitting device (100) which comprises light-emitting laver portion (24) which is composed group III-V compound semiconductor and a transparent thick-ពីim semiconductor layer (90) with a thickness of not less than 40 µm which is formed on at least one major surface side of the light-emitting layer portion (24) and composed of a group M-V compound senticonductor having a band gap energy larger than the photon energy equivalent of the peak wavelength of emission flux from the light-emitting layer portion (24). The transparent thick-film semiconductor layer (90) has a lateral surface portion (90S) which is a chemically etched surface. The dopant concentration of the transparent thick-film semiconductor layer (90) is not less than 5×10^{16} /cm³ and not more than $2 \times 10^{16}/\text{cm}^3$. By having such a structure, the

hight-emitting device can have a transparent thick-film semiconductor layer while being significantly improved in light taking-out elliciency from the lateral surface portion.

【 (57) 要約: 発光業子 100は、 I 1 I - V族化合物半導体からなる発光層部 24 と、該発光層部 24の少なくとも 一方の主表面側に形成され、発光層部 24 からの発光光東のピーク波長に相当する光量子エネルギーよりも大きな パンドギャップエネルギーを有する I I - V族化合物半導体からなる厚さ 40 μ m以上の透明厚膜半導体層 90と を有する。透明厚膜半導体層90は、側面部90Sが化学エッチング面とされ、かつ、該透明厚膜半導体層90のドーパント濃度が5×10~0/0/cm3以上2×10~0/0/cm3以下とされる。これにより、透明厚膜半導体層を有す るとともに、その側面部からの光取り出し効率を飛躍的に高めることができる発光素子を提供する。